

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年3月26日(26.03.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/041207 A1

- (51) 国際特許分類:
C09D 183/04 (2006.01) C09D 183/14 (2006.01)
C08J 7/04 (2006.01) C09D 183/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/074401
- (22) 国際出願日: 2014年9月16日(16.09.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-192148 2013年9月17日(17.09.2013) JP
- (71) 出願人: A Zエレクトロニックマテリアルズマ
ニユファクチャリング株式会社(AZ ELECTRON-
IC MATERIALS MANUFACTURING (JAPAN) KK)
[JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込2丁目2
8番8号 文京グリーンコート Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 尾崎 祐樹(OZAKI Yuki); 〒4371412 静岡
県掛川市千浜3330 A Zエレクトロニック
マテリアルズマニユファクチャリング株式会
社内 Shizuoka (JP). 佐竹 昇(SATAKE Noboru); 〒
4371412 静岡県掛川市千浜3330 A Zエ
レクトロニックマテリアルズマニユファクチャ
リング株式会社内 Shizuoka (JP). 河戸 俊二
(KAWATO Shunji); 〒4371412 静岡県掛川市千浜
3330 A Zエレクトロニックマテリアルズ
マニユファクチャリング株式会社内 Shizuoka
(JP). 小林 政一(KOBAYASHI Masakazu); 〒
4371412 静岡県掛川市千浜3330 A Zエ
レクトロニックマテリアルズマニユファクチャ
リング株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外(KATSUNUMA Hirohito et
al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目6番
6号 日本生命丸の内ビル 協和特許法律事務
所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー
ラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: FILM-FORMING COMPOSITION AND FILM-FORMING METHOD USING SAME

(54) 発明の名称: 被膜形成用組成物およびそれを用いた被膜形成方法

(57) Abstract: [Problem] To provide a film-forming composition and a film-forming method with which it is possible to form a film having excellent gas barrier performance. [Solution] Disclosed is a film-forming composition comprising: a polysiloxane that does not include a hydroxyl group or a carboxyl group; a polysilazane; and an organic solvent. Also disclosed is a film-forming method comprising: coating a substrate with said composition; and exposing the same to light.

(57) 要約: [課題] ガスバリア性能に優れた被膜を形成することができる被膜形成用組成物と被膜形成方法の提供。 [解決手段] 水酸基またはカルボキシ基を含まないポリシロキサンと、ポリシラザンと、有機溶剤とを含んでなることを特徴とする被膜形成用組成物と、その組成物を基板に塗布し、露光することを含んでなる被膜形成方法。



WO 2015/041207 A1